_____ РЕАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ____ КРИСТАЛЛОВ

УДК 548.74

ОРИЕНТАЦИОННОЕ СООТНОШЕНИЕ И РАЗМЕРНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК Nb-МАТРИЦЫ И у-СИЛИЦИДА В КОМПОЗИТЕ СИСТЕМЫ Nb-Si

© 2019 г. А. В. Заводов^{1,*}, Д. В. Зайцев¹, Н. А. Кузьмина¹, И. Л. Светлов¹

¹ Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов ГНЦ РФ, Москва, Россия

* *E-mail: zavodovad@gmail.com* Поступила в редакцию 02.04.2018 г. После доработки 26.12.2018 г. Принята к публикации 10.01.2019 г.

Методами просвечивающей электронной микроскопии установлены ориентационные соотношения между кристаллическими решетками твердого раствора Nb и частиц γ -силицидов Nb₅Si₃: {110}_{Nb}||{100} γ ; {111}_{Nb}||{001} γ . Плоскостями сопряжения являются плоскости двух типов: {110}_{Nb}||{100} γ и {111}_{Nb}||{001} γ . Плоскости первого типа образуют между собой ступеньки под углом 120°. Для подтверждения правильности вычисленных ориентационных соотношений и сравнения с экспериментальными картинами электронной дифракции использованы методы математического моделирования, позволяющие строить совмещенные электронограммы нескольких фаз и осуществлять наклон модельного кристалла. Построена модель межфазной границы в двух сечениях и предложено структурное обоснование морфологии поверхности раздела частицы и матрицы. Вычислено размерное несоответствие между кристаллическими решетками матрицы и γ -силицида.

DOI: 10.1134/S002347611905028X

введение

Кристаллография и морфология диффузионно-контролируемых твердотельных реакций во многом определяются ориентационными и размерными соотношениями между кристаллическими решетками матричной фазы и продуктов превращений. Этот принцип справедлив для всех без исключения твердофазных реакций в процессе термической обработки или эксплуатационной деградации структуры и свойств различных сплавов — магниевых, титановых, циркониевых, железных, никелевых, кобальтовых и других с различными кристаллическими решетками.

Существует несколько прогнозных моделей, среди которых стыковая модель совпадения наиболее проста и эффективна для предсказания ориентационных соотношений и габитусных плоскостей в гетерогенных сплавах, состоящих из фаз с различными кристаллическими решетками [1]. Например, согласно этой модели, индексы параллельных плоскостей и направлений, а также габитусных плоскостей в системах ГПУ–ОЦК существенно зависят от отношения периодов кристаллических решеток сопрягаемых фаз [2]. Модель предсказывает возможную зигзагообразную структуру границы раздела между сопрягающимися решетками [2, 3]. В теории и практике физического материаловедения никелевых и кобальтовых жаропрочных сплавов ориентационные соотношения и размерные несоответствия периодов кристаллических решеток фаз являются важными параметрами, определяющими термостабильность и микроструктуру при высоких напряжениях и температурах [4–8].

Аналогичные проблемы возникают в естественных эвтектических композитах на основе легированной системы Nb–Si, состоящих из Nb-матрицы с ОЦК-решеткой и армирующей фазы в виде силицидов ниобия Nb₅Si₃ различных полиморфных модификаций α и γ [9]. Силицид α -Nb₅Si₃ имеет тетрагональную кристаллическую решетку, а силицид γ -Nb₅Si₃ – гексагональную [10–13]. Многообразие вариантов сопряжения фаз различных модификаций в композитах Nb–Si разных составов является причиной неоднозначности экспериментально определенных ориентационных соотношений [14–18].

В связи с этим основные задачи настоящей работы состояли в экспериментальном определении аксиальной текстуры Nb-матрицы и армирующей фазы γ-силицида, формирующейся в процессе получения композита методом направленной кристаллизации, ориентационного соотношения между силицидами и Nb-матрицей, а также размерно-



Рис. 1. Прямые полюсные фигуры в поперечном сечении монолитного образца: a -отражение 222_{Nb} ; 6 -отражение 002_{γ} .

го несоответствия межплоскостных расстояний сопрягаемых плоскостей на границе раздела Nbматрицы и γ-силицида.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Композиты системы Nb–Si–Ti–Hf–Al–Cr– Мо–W–Zr получали в два этапа: вначале получали сплав, близкий к эвтектическому составу с равноосной структурой (прекурсор), а затем собственно композиты методом направленной кристаллизации прекурсоров. Для выравнивания микроликвационной неоднородности слитки гомогенизировали в вакууме в течение 10 ч.

Методом рентгеновской дифракции определено направление преимущественного роста Nbматрицы и силицида ниобия. Для съемки использовали цилиндрический образец с полированной торцевой поверхностью. Для удаления деформированного слоя применяли электролитическое травление. Съемку проводили на дифрактометре ДРОН-4 в геометрии Брэгга–Брентано (Си K_{α} -излучение), применяли θ -2 θ -сканирование в диапазоне углов 2 θ 30°–142°.

Образцы для просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) изготовили в виде дисков таким образом, чтобы их плоскости были перпендикулярны и параллельны оси кристаллизации. Полученные диски утоняли на SiC-бумаге до 50 мкм, а далее в среде аргона на установке ионного травления PIPSII фирмы Gatan.

Дифракционный анализ проводили с помощью микроскопа Jem 200 СХ фирмы Jeol при рабочем ускоряющем напряжении 160 кВ и длине камеры 820 мм. Анализ дифракционных картин и вычисление ориентационных соотношений вы-

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 64 № 5 2019

полняли с применением методов математического моделирования. Прямые ПЭМ-изображения получены в микроскопе Tecnai G2 F20 S-TWIN фирмы FEI при рабочем ускоряющем напряжении 200 кВ.

Ориентационные соотношения между кристаллическими решетками твердого раствора Nb (матрица) и силицидами ниобия γ -Nb₅Si₃ вычисляли в несколько этапов. Сначала определяли тип и параметры кристаллических решеток матрицы и силицидов (периодов и углов), затем получали электронограммы с совмещенными сетками на межфазной границе. После этого задавали ориентационные соотношения и моделировали дифракцию на двух фазах. На последнем этапе проводили проверку совпадения расчетных дифракционных картин с экспериментальными при двух угловых положениях образца.

Все матричные вычисления осуществляли в Mathcad. Результаты расчета визуализировали в программной среде Borland Delphi 7.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Определение аксиальной текстуры Nb-матрицы и фазы γ -Nb₅Si₃. На рис. 1 приведены прямые полюсные фигуры для отражений 222_{Nb} и 002_{γ}, полученные в поперечном сечении монолитного образца композита Nb–Si. Для матрицы Nb в поперечном сечении характерно наличие текстуры [111]. Выделения силицида ниобия γ -Nb₅Si₃ имеют текстуру [001]. Таким образом, направлениями роста монолитного образца являются направления типа $\langle 111 \rangle_{Nb} \| \langle 001 \rangle_{\gamma}$. Подобное соответствие направлений кристаллизации твердого раствора



Рис. 2. Микроструктура образца в поперечном сечении: а – первичные γ-силициды (светлые области); б – вторичные силициды, выделяющиеся в твердом растворе Nb_{тp}.

и силицидов совпадает с результатами, приведенными в [19, 20].

Определение ориентационных соотношений между силицидами и Nb-матрицей. Матрица сплава представляет собой твердый раствор Nb с ОЦК-решеткой. В исследуемом сплаве наблюдались силициды двух типов, различающиеся размерами и морфологией (рис. 2). Первые – это крупные силициды, образующиеся по эвтектоидной реакции в процессе направленной кристаллизации. На ПЭМ-изображениях (рис. 2а), полученных в режиме детектирования обратно отраженных электронов, ү-силициды соответствуют светлым областям. Вторые - более мелкие силициды, выпадающие при охлаждении из твердого раствора ниобия с уменьшением растворимости легирующих элементов (рис. 2б).

Все изученные силициды, как крупные, так и мелкие, обладают гексагональной решеткой (пр. гр. $P6_3/mcm$) с периодами $a_\gamma \approx 7.57$ и с $_\gamma \approx 5.21$ Å, соответствующими γ -силицидам ниобия. Период твердого раствора ниобия согласно данным рент-геноструктурного анализа составляет $a_{\rm Nb} \approx 3.27$ Å.

Первичный силицид. На рис. 3 приведена электронограмма граничной области матрицы с крупным силицидом на оси зоны $[111]_{Nb} \| [001]_{\gamma}$. Неравномерное распределение интенсивности двух сеток рефлексов связано в первую очередь с тем, что область селекторной диафрагмы наполовину занята матрицей, а наполовину – частицей силицида, что и приводит к такому эффекту.

Для составления ориентационных соотношений необходимо выбрать в двух решетках два совпадающих направления (они уже выбраны — это оси зон [111]_{Nb} и [001]_{γ}) и две параллельные плоскости. Параллельным плоскостям (*hkl*)_{Nb} и

 $(h'k'l')_{\gamma}$ соответствуют рефлексы $hkl_{\rm Nb}$ и $h'k'l'_{\gamma}$, лежащие на одной прямой с нулевым узлом обратной решетки. Таким свойством на рис. 3 облада-

ют, например, почти совпадающие рефлексы $0\overline{1}1_{Nb}$ и $0\overline{3}0_{v}$.

В общем виде, если в решетку Nb встроен хотя бы один γ -силицид, то одна из его плоскостей семейства $\{100\}_{\gamma}$ параллельна одной из плоскостей семейства $\{110\}_{Nb}$, а его ось $[001]_{\gamma}$ параллельна одной из осей семейства $\langle 111 \rangle_{Nb}$, что можно для краткости выразить в условной форме: $\{110\}_{Nb} \|\{100\}_{\gamma}$; $\langle 111 \rangle_{Nb} \|\langle 001 \rangle_{\gamma}$.

Ориентационные соотношения между двумя решетками можно определить матрицей перехода. Воспользуемся рис. 3, чтобы выразить каждый базисный вектор обратной решетки γ-силицида линейной комбинацией базисных векторов об-



Рис. 3. Электронограмма граничной области (ось зоны $[111]_{Nb} \| [001]_{\gamma}$). Крупные ромбы — решетка Nb, мелкие — решетка γ -силицида. Рефлексы от решеток Nb и γ -силицида обозначены крупными и мелкими символами соответственно.



Рис. 4. Наложение расчетных электронограмм на экспериментальные: а – ось зоны $[111]_{Nb} \| [001]_{\gamma}$; б – ось зоны $[225]_{Nb} \| [\overline{1} \overline{1} \overline{3}]_{\gamma}$ после наклона на 26° относительно $[111]_{Nb}$.

ратной решетки ниобия. Обозначив символом **H**(*hkl*) радиус-вектор узла *hkl*, запишем:

$$\mathbf{H}(100)_{\gamma} \| \mathbf{H}(10\overline{1})_{\mathrm{Nb}}; \ \mathbf{H}(010)_{\gamma} \| \mathbf{H}(01\overline{1})_{\mathrm{Nb}}; \\ \mathbf{H}(001)_{\gamma} \| \mathbf{H}(111)_{Nb}.$$

Последняя пара векторов направлена по осям двух зон [001], [111].

Обозначив базисы обратных решеток силицида и ниобия как $(\mathbf{a}_1^*, \mathbf{a}_2^*, \mathbf{a}_3^*)$ и $(\mathbf{A}_1^*, \mathbf{A}_2^*, \mathbf{A}_3^*)$ соответственно, свяжем системы координат двух обратных решеток следующими преобразованиями:

$$\mathbf{a}_{1}^{*} = 0.353\mathbf{A}_{1}^{*} - 0.353\mathbf{A}_{3}^{*},$$
$$\mathbf{a}_{2}^{*} = 0.353\mathbf{A}_{2}^{*} - 0.353\mathbf{A}_{3}^{*},$$
$$\mathbf{a}_{3}^{*} = 0.362\mathbf{A}_{1}^{*} + 0.362\mathbf{A}_{2}^{*} + 0.362\mathbf{A}_{3}^{*},$$

т.е. $\mathbf{a}_{i}^{*} = (\alpha_{ik}) \mathbf{A}_{k}^{*}$, где

$$(\alpha_{ik}) = \begin{pmatrix} 0.353 & 0 & -0.353 \\ 0 & 0.353 & -0.353 \\ 0.362 & 0.362 & 0.362 \end{pmatrix}$$

матрица перехода.

Коэффициенты матрицы при векторах A_k^* найдены по формуле:

$$\alpha_{ik} = \frac{|\mathbf{H}_i|}{|\mathbf{a}_i^*|} h_{ik} \cdot \mathbf{A}_k^*,$$

где **H**_i — радиус-вектор узла *hkl* на электронограмме решетки Nb, направленный вдоль *i*-го базисного вектора **a**_i^{*} обратной решетке γ -силицида; h_{ik} — соответствующий индекс Миллера, т.е. *h*, *k* или *l*. Для вычисления брали следующие параметры решеток: $a_{\gamma} = 7.57$, $c_{\gamma} = 5.21$, $a_{\rm Nb} = 3.27$ Å.

Известно, что матрица перехода, связывающая базисы двух обратных решеток, преобразует

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 64 № 5 2019

также координаты узлов прямой решетки к разным базисам. Поэтому при умножении вектора [111]_{Nb} на матрицу (α_{ik} слева получим параллельный ему вектор в решетке γ -силицида:

$$\begin{bmatrix} uvw \end{bmatrix}_{\gamma} = \begin{pmatrix} 0.353 & 0 & -0.353 \\ 0 & 0.353 & -0.353 \\ 0.362 & 0.362 & 0.362 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \end{pmatrix}_{Nb} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1.087 \end{pmatrix}_{\gamma}.$$

Для подтверждения правильности результатов покажем на рис. 4а наложение дифракционной картины на оси зоны [111]_{Nb}, рассчитанной по программе Electronogramm (свидетельство о гос. регистрации № 2018619581). На удалении от центра картины, где интенсивность матричных отражений низка и не засвечивает отражения силицида, можно наблюдать разделение рефлексов $\overline{360}_{\gamma}$ и $\overline{123}_{Nb}$, что очень хорошо воспроизводится в расчетной дифракционной картине. Для проверки ориентационного соотношения наклоним реальный кристалл и модельный на один и тот же угол, например, на 26°. Совмещенная картина

дифракции на рис. 46 подтверждает правильность расчетов и заданного ориентационного соотношения.

Вторичный силицид. На рис. 5 представлены электронограммы выделенной области с мелким силицидом. Из электронограммы на оси зоны [111]_{Nb} видно, что ориентации вторичного и первичного силицидов различаются.

Предположив, что такая ориентация является одним из эквивалентных вариантов указанного выше соотношения, методом перебора всех возможных ориентаций, рассчитанных программой, нашли направление $[22\overline{1}]_{\gamma}$ удовлетворяющее электронограмме на рис. 5а.



Рис. 5. Электронограммы матрицы и силицида при двух углах наклона относительно плоскости фольги: $a - 0^\circ$, ось зоны [111]_{Nb} $\|[22\overline{1}]_{\gamma}$; $6 - 34^\circ$, ось зоны [110]_{Nb} $\|[210]_{\gamma}$.

Наклонив образец на 34° относительно направления [$\overline{1}10$], получили вторую электронограмму на оси зоны [110]_{Nb} (рис. 56), которая полностью совпадает с расчетной. Ориентационные соотношения в этом случае и матрица перехода представляются как:

$$(110)_{\text{Nb}} \| (100)_{\gamma}, [1\,\overline{1}\,\overline{1}\,] \| [001]_{\gamma},$$
$$(\alpha_{ik}) = \begin{pmatrix} 0.353 & 0.353 & 0\\ 0.353 & 0 & 0.353\\ 0.362 & -0.362 & -0.362 \end{pmatrix}.$$

Для расчета осей зон силицида в направлениях Nb-матрицы [111]_{Nb}, (рис. 5) умножим соответствующие векторы на матрицу (α_{ik}) слева:

$$[uvw]_{\gamma} = (\alpha_{ik}) \begin{pmatrix} 1\\1\\1 \end{pmatrix}_{Nb} = \begin{pmatrix} 0.705\\0.705\\-0.362 \end{pmatrix}_{\gamma};$$
$$[uvw]_{\gamma} = (\alpha_{ik}) \begin{pmatrix} 1\\1\\0 \end{pmatrix}_{Nb} = \begin{pmatrix} 0.705\\0.353\\0 \end{pmatrix}_{\gamma},$$

где направления векторов гексагональной решетки [0.705 0.705 0. $\overline{362}$] и [0.705 0.353 0] совпадают с направлениями векторов [$22\overline{1}$]_γ и [220]_γ соответственно, являющихся осями зон γ-силицида на рис. 5.

Определение сопрягающихся плоскостей матрицы и γ-силицида. Определив ориентационные соотношения между кристаллическими решетками матрицы и силицида, нельзя сказать, по каким плоскостям проходит межфазная граница. Ориентационные соотношения задают только расположение двух решеток друг относительно друга, но ничего не говорят о плоскости раздела матрицы и частицы силицида. Кроме того, возникает вопрос о геометрии границы. Какие плоскости формируют границу раздела фаз и замыкают ее вокруг объемной частицы силицида?

Результаты исследования межфазной границы в режиме детектирования прямого пучка позволили ответить на эти вопросы. На рис. 6 показана межфазная граница между твердым раствором Nb и частицей первичного силицида Nb₅Si₃. На рис. 6а ориентация матрицы и силицида соответственно [111]_{Nb} и [001]_γ. Граница между матрицей и силицидом параллельна направлению [$\overline{2}$ 11]_{Nb} матрицы или [010]_γ силицида. Однако было бы некорректно утверждать, что граница находится в плоскости типа (110)_{Nb}||(100)_γ, не убедившись, что при данной ориентации образца межфазная граница направлена перпендикулярно изображению.

С этой целью подготовили образец, плоскость которого перпендикулярна плоскости первого образца, а ориентация совпадает с ориентацией матрицы $[\overline{2}11]_{Nb}$, и убедились, что межфазная граница проходит вдоль направления матрицы $[111]_{Nb}$ или $[001]_{\gamma}$ силицида. Это позволяет однозначно утверждать, что граница раздела фаз проходит по плоскостям типа $(110)_{Nb} \| (100)_{\gamma}$. Также при этой ориентации наблюдается второй тип границ, образующий с плоскостями типа $(110)_{Nb} \| (100)_{\gamma}$.

Определение размерного несоответствия межплоскостных расстояний сопрягающихся плоскостей матрицы Nb и γ-силицида. На рис. 7 схематично изображена граница раздела между ОЦКматрицей и частицей силицида. На данной схеме слева обозначена область матрицы в направлении [111], разными оттенками обозначены плоскости *A*, *B* и *C*, располагающиеся на разных уровнях. Справа – область силицида ниобия, где светлыми кругами обозначены узлы элементарной ячейки. Темные круги представляют собой сечение при-



Рис. 6. Межфазная граница между Nb_{тр} и γ-силицидом в направлении [111]_{Nb}: а – исходное изображение; б – после фурье-преобразования.

митивной гексагональной решетки в направлении [001], имеющей период приблизительно в 3 раза меньший, чем у силицида. Такое представление позволяет проще изобразить сопряжение двух решеток.

На рис. 6б, полученном после фурье-обработки изображения высокого разрешения, подробно показано сопряжение Nb-матрицы с силицидом. Плоскости (011) твердого раствора переходят в плоскости (010) гексагональной решетки силицида. На одно межплоскостное расстояние (010)_γ приходятся три межплоскостных расстояния (011)_{Nb}. Замечено, что период кристаллической решетки твердого раствора Nb меняется от 3.15 Å вблизи границ с силицидами до 3.29 Å вдали от



Рис. 7. Схема межфазной границы между Nb-матрицей и γ-силицидом.

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 64 № 5 2019

частиц, что подтверждается прямыми изображениями. Это может быть связано с искажениями кристаллической решетки твердого раствора Nb вблизи частиц силицида.

Используя параметры решетки $a_{\rm Nb} = 3.15$ и $a_{\gamma} = 7.59$ Å, по стандартным формулам находим межплоскостные расстояния сопрягающихся плоскостей:

$$Bd(0\overline{1}1)_{\rm Nb} = 6.68$$
 Å; $d(010)_{\rm V} = 6.57$ Å.

Различие в межплоскостных расстояниях определяет несовпадение кристаллических решеток при стыковке Nb-матрицы и γ -силицида Nb₅Si₃ на межфазной границе и выражается в данном случае как:

$$\Delta_{\rm Nb/\gamma} = 2 \frac{3d(0\,11)_{\rm Nb} - d(010)_{\gamma}}{3d(0\,\overline{1}1)_{\rm Nb} + d(010)_{\gamma}} \times 100\% = 1.66\%.$$

Для сравнения следует привести степени несовпадения решеток в монокристаллах жаропрочных никелевых и кобальтовых сплавов: 0.2-0.5% [18] и 0.5-0.9% [19] соответственно. В случае монокристаллов жаропрочных никелевых и кобальтовых сплавов матрицей является твердый раствор с ГЦК-решеткой, а упрочняющей фазой – частицы интерметаллидной у'-фазы также с ГЦКрешеткой. Таким образом, в данном случае сопрягаются фазы ГЦК-ГЦК. В исследованном композите на основе легированной системы Nb-Si матрицей является твердый раствор ниобия с ОЦК-решеткой, а армирующей фазой γ-Nb₅Si₃ – силицид ниобия с гексагональной решеткой. Здесь происходит сопряжение фаз ОЦК-ГПУ и, как следствие, несовпадение решеток в ниобиевом композите больше – 1.66%.

Формирование границы замкнутого тела. Межфазная граница является трехмерным объектом и должна замыкаться, образуя ограниченную об-

Рис. 8. Схематичное разбиение криволинейной границы эквивалентными плоскостями.

ласть. Морфология границы раздела зависит, в частности, от типа сопрягаемых кристаллических решеток. Для образования замкнутого контура линия границы должна постоянно изменять направление. Вероятно, изменяя направление, граница образует ступеньку, оставаясь в эквивалентных плоскостях типа {110}_{Nb} || {100}_у. Угол между двумя эквивалентными плоскостями таких типов составляет 120°. Продолжая таким образом отклоняться, граница образует замкнутый контур. На рис. 8 справа схематично изображено разбиение криволинейной межфазной границы на прямолинейные отрезки в одних и тех же эквивалентных плоскостях. Подтверждение такого поведения границы можно увидеть на рис. 6а, где она образовала две ступеньки в направлении $[\overline{1}\,\overline{1}\,0]_{\nu}$.

В другом сечении при ориентации матрицы $[\overline{2}11]_{Nb}$ плоскостью сопряжения является плоскость $(001)_{\gamma} || (111)_{Nb}$, располагающаяся под углом 90° к плоскостям типа $\{110\}_{Nb}$. На рис. 8 слева представлено разбиение криволинейной границы в продольном сечении. Таким образом, весь объем частицы Nb₅Si₃ можно сложить из правильных шестигранных призм. На поверхность тела будут выходить плоскости двух типов: $\{100\}_{\gamma}$ и $\{001\}_{\gamma}$.

Отметим, что при образовании ступеньки под углом 90° межфазная граница каждый раз переходит в эквивалентную плоскость другого типа, в то время как разворот границы на 120° оставляет ее в тех же эквивалентных плоскостях $\{110\}_{Nb} \| \{100\}_{\gamma}$.

выводы

В сплаве системы Nb—Si после направленной кристаллизации вдоль ориентационной оси [111] матрицы ниобия обнаружены γ -силициды двух типов: первичные, ориентированные вдоль направления [001]_{γ}, и вторичные, имеющие различные ориентации, удовлетворяющие ориентационному соотношению в общем виде.

С применением математического моделирования и наложения расчетных электронограмм на экспериментальные картины дифракции определены ориентационные соотношения между үсилицидами и Nb-матрицей. Кристаллические решетки всех силицидов характеризуются общими соотношениями с матрицей: {110}_{Nb}||{100}_γ; {111}_{Nb}||{001}_γ.

Методом высокоразрешающей микроскопии определены плоскости сопряжения силицида с матрицей Nb: $\{110\}_{Nb} \| \{100\}_{\gamma}$ и $\{111\}_{Nb} \| \{001\}_{\gamma}$. Предложена модель сопрягающихся плоскостей и вычислено их размерное несоответствие на границе раздела фаз, составляющее 1.66%.

Обоснована зигзагообразная морфология границы раздела фаз, при которой образуются ступеньки двух типов — под углами 120° и 90°. Межфазная граница всегда остается в эквивалентных плоскостях двух типов: {100}, и {001},

Работа выполнена в рамках развития комплексного научного направления 2.1. "Фундаментально-ориентированные исследования" ("Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года") [21].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Zhang M.-X., Kelly P.M. // Scripta. Mater. 2005. V. 52. P. 965.
- Zhang M.-X., Kelly P.M. // Acta Mater. 2009. V. 53. P. 1073.
- 3. *Zhang M.-X., Kelly P.M.* // Acta Mater. 2009. V. 53. P. 1085.
- Каблов Е.Н., Светлов И.Л., Ефимочкин И.Ю. // Вестн. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. "Машиностроение". 2011. № SP2. С. 164.
- 5. Каблов Е.Н., Светлов И.Л., Карпов М.И. и др. // Материаловедение. 2017. № 2. С. 24.
- 6. Оспенникова О.Г., Рассохина Л.И., Битюцкая О.Н., Гамазина М.В. // Тр. ВИАМ: электрон. науч.-технич. журн. 2017. № 4. С. 3.
- Лощинин Ю.В., Дмитриева В.В. Пахомкин С.И., Размахов М.Г. // Авиационные материалы и технологии. 2017. № 2 С. 41.
- 8. Каблов Е.Н., Бондаренко Ю.А., Ечин А.Б. // Авиационные материалы и технологии. 2017. № S. C. 24
- 9. Светлов И.Л., Кузьмина Н.Ф., Нейман А.В. // Материаловедение. 2015. № 3. С. 50.

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ том 64 № 5 2019



- 10. *Кузьмина Н.А., Еремин Н.Н., Марченко Е.И. и др. //* Кристаллография. 2018. Т. 63. № 3. С. 358.
- 11. Каблов Е.Н., Кузьмина Н.А., Еремин Н.Н. и др. // Журн. структур. химии. 2017. Т. 58. № 3. С. 547.
- 12. *Марченко Е.И., Кузьмина Н.А., Еремин Н.Н. //* Тр. ВИАМ: электрон. науч.-техн. журн. 2017. Т. 51. № 3. С. 35.
- 13. *Guo J.T., Tian Y.X., Gheng G.M. et al.* //J. Alloys Compd. 2009. V. 470. P. 606.
- Sekido N., Wei F.G., Kimura Y. et al. // Philos. Mag. Lett. 2006. V. 86. P. 89.
- Cheng G.M., Tian Y.X., He L.L. // J. Mater. Res. 2009. V. 24. P. 192.

- Cheng G., Tian Y., He L. et al. // Philos. Mag. 2009. V. 89. P. 2801.
- 17. *Li Y.L., Ma C.L., Zhang H.* Proc. ASME Turbo Expo 2013. Texas, June 3–7, 2013. P. V05AT21A006.
- Tian Y.X., Guo J.T., Gheng G.M. et al. // Mater. Des. 2009. V. 30. P. 2274.
- Ma X., Guo X., Fu M., Guo H. // Scripta. Mater. 2017. V. 139. P. 108.
- Li Y., Miura S., Ohsasa K. et al. // Intermetallics. 2011.
 V. 19. P. 460.
- 21. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Пискорский В.П. и др. // Авиационные материалы и технологии. 2015. № S2. C. 5.